半極性(1122)InGaN/AlGaN 応力補償超格子の光学特性

Optical Properties of Semipolar (1122) InGaN/AlGaN Stress-Compensated Superlattices

京大院工 ○西中 淳一⁺, 船戸 充, 川上 養一

Kyoto Univ. [°]Junichi Nishinaka[†], Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami

[†]現所属:NTT 物性研(NTT Basic Research Laboratories)

E-mail: <u>kawakami@kuee.kyoto-u.ac.jp</u>

【はじめに】半極性(1122) InGaN 量子井戸(QW)は内部電界が小さいため, 輻射再結合確率が高い[1]. さらに, この面方位の特徴である偏光スイッチ現象は[2], 劈開面{1100}を長波長領域のレーザダ イオード(LD)のミラーとして用いる際に有利に働くと考えられる.しかしながら, 半極性(1122) GaN 上のヘテロエピタキシでは臨界膜厚が比較的小さいため[3], 構造設計の自由度が制限されて しまう. InAlGaN 四元混晶は GaN に格子整合させつつバンドギャップおよび屈折率を変化させる ことができるが, 組成制御が難しい. そこで, InGaN/AlGaN 応力補償超格子(SCSL)を擬似四元混晶 として用いることを提案し, 比較的厚い膜のコヒーレント成長を実証した[4]. SCSL は InGaN, AlGaN それぞれの組成と膜厚比で平均組成の制御を行えるため, InAlGaN 単層膜に比べて作製が 容易である.本研究では, 作製した(1122) InGaN/AlGaN SCSL の光学特性について報告する.

【実験方法】半極性(1122)GaN バルク基板上に,有機金属気相成長法によりGaN ホモエピタキシャ ル膜 2 µm を成長した後, In_{0.2}Ga_{0.8}N (1 nm) / Al_{0.2}Ga_{0.8}N (3 nm) SCSL を 125 周期成長した. 原料には TMGa, TMIn, TMAI, NH₃を用い,成長圧力は 300 Torr,成長温度は 800°C とした.本稿では光学特 性評価の例として,室温(RT)におけるフォトルミネッセンス(PL)測定および分光エリプソメトリ の結果について示す.

【実験結果および考察】作製した SCSL のPL スペクトルを Fig. 1 に示す. 励起光は He-Cd レーザ(波 長: 325 nm)とした.約 2.9 eV の位置に SCSL 由来の PL ピークが見られる. これはクローニッヒ・ ペニーモデルによって計算した遷移エネルギーとほぼ一致する.次に,分光エリプソメトリによ って測定した SCSL および同一の炉で成長した GaN ホモエピタキシャル膜の屈折率分散を Fig. 2 に示す.特に,緑色領域(2.3—2.4 eV)において SCSL の方が GaN よりも屈折率が小さくなっている. しかも,厚くコヒーレントに成長可能であるため,LD のクラッド層として適した構造であると考 えられる.講演当日は SCSL の光学特性について詳細に議論する予定である.

【参考文献】

[1] M. Funato *et al.*, Appl. Phys. Express **3**, 071001 (2010). [2] M. Ueda *et al.*, Phys. Rev. B **78**, 233303 (2008). [3] J. Nishinaka *et al.*, J. Appl. Phys. **112**, 033513 (2012). [4] 西中他, 第61回春季応用物理学会 学術講演会, 19a-E13-9 (2014).





Fig. 1. RT-PL spectrum of semipolar $(11\bar{2}2)$ In_{0.2}Ga_{0.8}N (1 nm) / Al_{0.2}Ga_{0.8}N (3 nm) SCSL.

Fig. 2. Refractive index dispersions of the semipolar (1122) InGaN/AlGaN SCSL and a (1122) GaN homoepitaxial film measured by spectroscopic ellipsometry.